文章编号: 1001 3806(2004) 04 0394 03

# 斜入射时 BiCaInVIG 和 GdYBiIG 晶体旋光角变化的研究

王吉明,吴福全,封太忠,孔伟金 (曲阜师范大学 激光研究所,曲阜 273165)

摘要: 搭建了磁光晶体的磁致偏振特性测试实验系统。利用此实验系统,在可调磁场下,对两种光通信用磁 光晶体 BiCalnVIG 和 GdYBiIG 垂直入射与斜入射时旋光角的变化进行了测试。测试结果表明,该两类晶体均存在 Fanaday 效应的各向异性。

关键词: 磁光晶体; 旋光角; Faraday 效应; 斜入射 中图分类号: 0734 文献标识码: A

# The change of rotation angle for BiCaInVIG and GdYBiIG crystal at oblique incidence

WANG Ji-ming, WU Fu-quan, FENG Tai-zhong, KONG Weijin (Institute of Laser Research, Qufu Normal University, Qufu 273165, China)

**Abstract:** The optical system has been established in which the change of polarization state for magneto optic crystal can be measured. In the system, the rotation angles for two types of magneto optic crystals (BiCaInVIG and GdYBiIG) used in optical communication system have been measured at oblique incidence. The experiment results show that there is an isotropic distribution of Fanaday effect in the magneto optic crystal.

Key words: magneto optic crystal; angle of rotation; Faraday effect; oblique incident beam

## 引 言

磁光晶体在光通信用磁光式器件如磁光调制 器、磁光隔离器、磁光环行器等中是其核心组成部分 之一,它的光学特性直接关系到器件工作性能的优 劣。对改良磁光式器件而言、除对各分立器件组合 及设计进行研制外,最重要也是最有可能获得理想 结果的便是对作为其核心部件之一的磁光晶体的光 学特性进行研究。随着近年来国内外各种新型磁光 材料的出现,对这些新型材料的综合光学性能进行 研究也越来越重要。

有关磁光晶体光学特性方面的研究,国内外仅 有少量的报道<sup>[1~5]</sup>,特别是国内在这方面的研究尚 不够系统<sup>[3,4]</sup>。由于各类磁光器件的理论基础是其 表现出的磁光效应,磁光晶体中这些效应受磁场变 化的规律将会直接影响其组成的磁光器件的工作性 能,因此,在可调磁场下,系统地对不同磁光晶体的

作者简介:王吉明(1977),男,博士研究生,从事光无源 器件的研究。 物理特性进行测量和分析,将是获得高性能磁光器件的必要途径之一。作者对两种光通信用磁光晶体 BiCalnVIG和 GdYBiIG 倾斜前后的旋光角进行了测试与比较,并给出理论解释;这对于提高由该类晶体 组成的磁光器件的性能具有重要的意义。

 可调磁场下磁光晶体倾斜前后旋光角的 测定

#### 1.1 磁光晶体磁致偏振特性测试实验系统

磁光晶体磁致偏振特性测试系统主要用于可调 谐磁场下对光通信用磁光晶体的各项参数进行测 量,包括对透射比、Faraday 旋转角、消光比、退偏度 等的测量。该测试系统采用了偏光测试实验中常用 的消光法:将样品置于两偏光镜之间,对磁光晶体逐 渐加大磁场,旋转检偏镜,利用消光位置测量检偏器 转过的角度,并记录不同磁场下透射光强的最大值 和最小值,得到Faraday 旋转角及其它参数。

实验装置及光路图如图1所示。图中:1是 WGY 型半导体激光器;2是光阑;3是格兰-泰勒棱 镜;4是 JG-3型电磁铁;5是 WWL-3型直流恒压恒 流电源(100V/16A);6是待测磁光晶体样品;7是格

E-mail: jimingw@eyou.com

收稿日期: 2003 07 21; 收到修改稿日期: 2003 11-25



Fig. 1 Devices and beam path for measuring the performance of magneto optic crystal

兰汤普逊棱镜; 8 是测角仪; 9 是 AV2494 型光功率 计; 10 是磁强计。

该测试系统利用 WGY 型半导体激光器做光 源,光源波长为 λ= 1538nm;两只偏光镜选用原则是 透射比高、消光比好并且透射光束偏离角小于 í,此 处选用的是经过严格挑选的格兰-泰勒棱镜和格兰-汤普逊棱镜;电磁铁与直流电源是专为磁光晶体磁 致偏振特性测试系统定做,能产生大范围的恒向磁 场(超过 0mT~ 1500mT),可对磁场变化情况下磁光 晶体的性能进行测定;实验中根据实验要求对磁场 仪(小磁场时的稳定性)及测角仪(测量精度)进行了 改进;在调整光路时,根据使用的红外激光光源的特 点,采用了先利用 He Ne 激光器的可见光波粗校,然 后换用半导体激光器精确校准光路的方法。

1.2 斜入射对旋光角影响的实验结果

在实验中 BiCalnVIG 晶体与 GdYBiIG 晶体的样 品均已镀制增透膜。图 2 是样品倾斜时光线入射的 情况,外磁场方向与入射光波方向一致。实验中,将 样品倾斜放置,使得入射角在  $\alpha = 05$  附近。从图中 可以发现,在晶体内部,磁场方向与光线方向不再严 格一致,两者出现了小的偏离。两类晶体折射率近 似取 n = 2.3,可以得出  $\beta \approx 8.5°$ 。



Fig. 2 Beam path when the incoming wave is oblique

1.2.1 BiCalnVIG 晶体 实验中对 BiCalnVIG 晶体 样品 1号、2号在垂直入射、斜入射的情况的旋光角 做了测试。1号、2号样品厚度相近,分别为 0.756mm, 0.753mm, 旋光角都在 45°附近。实验结果 如图 3 所示。



Fig. 3 Charges of angle of rotation for BiCaInVIG crystal at normal and oblique incident angle

从图中可以看出,两样品倾斜前后,旋光角变化 规律相似。BiCaInVIG 晶体磁饱和磁场较小,约为 40ml,因此磁场达到 40mT(图中虚线位置)之后,两 样品旋光角都趋于稳定。垂直入射时,1,2号晶体 达到磁饱和后的旋光角约为  $\theta_1$ = 45.2°,  $\theta_2$ = 44.7。 斜入射时,1,2号晶体的磁饱和旋光角分别为  $\theta_1'$ = 44.3°,  $\theta_2'$ = 43.3°,与垂直入射时相比,均有不同程 度的变小:1号样品旋光角减小了约 0.9°,2 号减小 了约 1.4°。这说明斜入射引起了旋光角的减小。 1.2.2 GdYBiIG 晶体 图 4 是斜入射前后GdYBiIG 样品的旋光角随磁场变化的曲线图。GdYBiIG 属复 合稀土铁石榴石单晶,样品沿垂直于[111] 面切割,



Fig. 4 Changes of angle of rotation for GdYBiIG crystal at normal and oblique incident angle

厚度为 2. 702mm。它的磁饱和强度较BiCaInVIG为 大,当外磁场为 75mT 左右时达到磁饱和。因此自 75mT 开始,随磁场增加,旋光角变化趋于稳定(虚线 位置)。垂直入射与斜入射时的磁饱和旋光角分别 为  $\theta$ = 30.  $0^{\circ}$ ,  $\theta^{\prime}$  = 34.  $3^{\circ}$ , 斜入射时的旋光角总是大 于垂直入射的情况。晶体达到磁饱和后, 斜入射前 后的旋光角相差约 4.  $3^{\circ}$ 。

2 理论分析

因样品均已镀制增透膜,在斜入射时可以忽略 掉表面反射对透射光的影响。根据 Faraday 旋转角 公式,垂直入射与斜入射时,旋光角分别为:  $\left(\theta = \pi L(n_{+} - n_{-})/\lambda\right)$ 

$$\begin{cases} \theta = \pi L[(n_{+} - n_{-}) + \Delta(n_{+} - n_{-})] \left(\frac{L}{\cos\beta}\right) \\ \lambda \end{cases}$$

式中,  $\theta$ ,  $\theta'$  分别为垂直与斜入射时的旋光角;  $n_+$ ,  $n_-$  为左、右旋圆偏振光在晶体中的折射率;  $\Delta(n_+ - n_-)$ 为斜入射与垂直入射时左、右旋圆偏振光折射 率差值之差: *L* 为样品厚度。

对于 BiCaInVIG 晶体的两样品, 根据对图 3 的分 析, 斜入射时旋光角变小, 故可以得出两圆偏振光光 程差变小。根据(1) 式中的第 2 项,  $L/\cos\beta > L$ , 因此 必有  $\Delta(n_+ - n_-) < 0$ , 这说明斜入射时左、右旋圆 偏振光折射率差值变小, 从而导致斜入射方向上旋 光角变小, 即 Faraday 效应减弱。将斜入射前后 1 号、2 号的旋光角分别代入到(1) 式中两式并联立 经计算得出 1, 2 号样品斜入射前后左、右旋圆偏振 光折射率差值的变化分别为:

$$\Delta (n_{+} - n_{-})_{1} = -0.69 \times 10^{-5}$$

$$\Delta (n_{+} - n_{-})_{2} = -2.13 \times 10^{-5}$$
(2)

由上式可以得出,两样品斜入射前后两圆偏振光折 射率差值变化的大小不同,但差值均变小。变化大 小的不同主要是因为不同样品间的厚度有差别,并 且样品的切割方向也稍有差别,因此导致斜入射方 向上 Faraday 旋转变化情况也不同。

对于 GdYBiIG 的样品,用以上同样的方法分析, 可以得出斜入射前后左、右旋圆偏振光折射率差值 的变化为:

$$\Delta(n_{+} - n_{-}) = 1.24 \times 10^{-5} \qquad (3)$$

(3) 式说明斜入射方向上 Faraday 效应增强, 与 BiCaInVIG晶体两样品的情况相反。并且, 由于实验

- [10] 侯春风,李师群,李 斌 et al. 有外加电场的光伏光折变晶体 中非相干耦合亮 暗屏蔽光伏孤子对 [J]. 物理学报, 2001, 50 (9): 1709~1712.
- $[\,11]$   $\,$  LIU J S, SHI Sh X, LI M H  $et\ al$  . Temperature dependence of two

中此样品厚度远大于 BiCaInVIG 样品厚度(约是其 3.6倍),斜入射时样品光程变化较大,因此,旋光角 变化也较大。

以上实验结果的分析说明:磁光晶体斜入射时 后,其旋光角发生变化,这说明两种晶体中均存在 Faraday 效应的各向异性现象。

### 3 结 论

磁光晶体存在 Faraday 效应的各向异性,导致了 斜入射前后旋光角会发生变化(增大或减小)。在装 配磁光式器件过程中,磁光晶体通光面不可能做到 与入射光路严格垂直,这将会使得其旋光角发生微 小的变化,并且,对于同种材料的磁光晶体,由于厚 度之间的微小差异以及切割方向不完全一致,因而 旋光角变化的程度也不同。以制作高隔离度的光隔 离器件为例,通常要求磁光晶体的旋光角为45,否 则,旋光角的微小变化都会影响到隔离度的变化。 由于晶体的切割、研磨及镀制增透膜过程均会影响 旋光角的大小,故很难保证加工后晶体的旋光角为 严格的45°。一个解决办法是根据磁光晶体倾斜后 增大或减小的实际情况,在装配过程中使得入射光 线以一微小的入射角入射到磁光晶体, 通过微调入 射角的大小使晶体的旋光角尽量接近 45°。以实验 中的 BiCaInVIG 晶体为例, 在装配过程中, 若晶体旋 光角稍大于 45°, 可通过将 BiCalnVIG 晶体稍微倾斜 的方法来获得更加接近 45°的旋光角。

#### 参考文献

- WOLF R, FRATELLO V J, McGLASHAN POWELL M. Thir film gar net materials with zero linear birefringence for magneto optic waveguide devices(invited) [J]. J A P, 1988, 63(8): 3099~ 3103.
- [2] CORIANI S, JORGENSEN P, RIZZO A et al. Ab initio determinations of magnetic circular dichrosim [J]. Chem Phys Lett, 1999, 25(1):61 ~ 68.
- [3] 王光辉,吴福全,张 波.磁致线双折射对法拉第旋转器消光
   比的影响[J].光电子·激光,1999,10(3):218~220.
- [4] 王光辉,吴福全.磁致圆二向色性对法拉第旋转器消光比的影响[J].激光技术,1999,23(6):350~352.
- [5] MA X M, LIAN Ch H. Effect of antireflection coating on the performance of Faraday rotators [ J]. Appl Opt, 1994, 33(19): 4300~ 4303.
- [6] 刘公强,乐志强,沈德芳.磁光学[M].上海:上海科学技术出版 社,2001.45~52.

beam coupling in CeLiNbO3 crystal [J]. Chinese Science Bulletin, 1992,  $37(9):718\sim721$ .

[12] CHENG L J, PARTOVI A. Temperature and intensity dependence of photorefractive effect in GaAs [J]. A P L, 1986, 49 (21): 1456~ 1458.

<sup>(</sup>上接第389页)